(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55-154955

⑤ Int. Cl.³C 07 D 209/86// G 03 G 5/06

識別記号

102

庁内整理番号 7242-4C 7265-2H 砂公開 昭和55年(1980)12月2日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 7 頁)

図新規なヒドラゾン化合物及びその製造法

②特

願 昭54-64119

29出

願 昭54(1979)5月24日

⑫発 明 者

酒井清 東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑫発 明 者 佐佐木正臣

東京都大田区中馬込1丁目3番

6号株式会社リコー内

⑫発 明 者 筒井恭治

東京都大田区中馬込1丁目3番

6 号株式会社リコー内

⑪出 願 人 株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番

6 号

個代 理 人 弁理士 小松秀岳

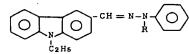
明 細 鸖

■1. 発明の名称

新規なヒドラゾン化合物及びその製造法

■2. 特許請求の範囲

(1) 一般式



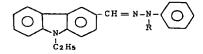
〔但し、Rはメチル基、フェニル基、ペンジル基を表わす〕

で示されるヒドラゾン化合物。

ルカルバゾール-3-アルデヒドと、一般式

〔但し、Rはメチル基、フェニル基、ベンジル基を表わす〕

で示される1-置換フェニルヒドラジンとを反 応させることを特徴とする一般式



(但し、Rはメチル基、フェニル基、ベンジル基を表わす)

で示されるヒドラゾン化合物の製造法。

3. 発明の詳細を説明

—399—

本発明は新規なヒドラゾン化合物及びその製造法に関する。

(1)

る画像形成法の一つである。このような電子写 真法において用いられる感光体に要求される基 本的な特性としては、(1) 暗所で適当な電位に帯 電できること、(2) 暗所における電荷の保持性が 良好なこと、即ち、暗滅衰速度が小さいこと、 (3) 光照射によって速やかに電荷を逸散せしめう ること、即ち光感衰速度が大きく光感度大であ ることの他、機械的強度、加工性等が優れてい ることが挙げられる。

(8)

要求を充分に満足するものではない。一般に低子写真用感光体の特性は、用いる材料、均均光海電性材料に負うところが大きい。そのわれれた。そのが大きいが大きいがでは盛んに行なわれて他では、前途の無機及び有機の光導電性材料を発生を対し、が、光明では、電荷を動物質という)との組合せ使用により光でである物質という)との組合せ使用により光で、いまだ充分満足する材料が得られていた。

本発明の目的は、前配従来の欠点を解決した 導電性材料を提供することであり、更にはその 製造法を提供することである。より詳しくは、 種々の電荷発生物質と共に用いることができる 電荷移動物質として極めて有用な新規なヒドラ ゾン化合物並びにその製造法を提供することに ある。 度、耐摩擦性などの機械的特性に劣るため、そのままでは反復使用ができず、例えば保護層等 を設ける必要が生し、複雑化する欠点がある。

近年、これら無機感光体の欠点を排除するた めに種々の有機光導電性材料を用いた有機電子 写真用感光体が研究・開発され、実用に供され ている。例えば、支持体上に、ポリーN-ヒニ ルカルバゾールと 2,4,7 - トリニトロフルオレ ン-9-オンを含有する感光層を設けた感光体 (米国特許第 3.4 84.2 37 号公報参照)、ピリリウ ム塩系色素で増感したポリーN-ビニルカルバ ゾール含有の感光層を設けた感光体(特公昭48 - 25658 号公報参照)、有機顔料を主成分とす る 感光 層 を 設 け た 感 光 体 (特 開 昭 47 - 37543 号 公報参照)、染料と樹脂とからなる共晶錯体を 主成分とする感光層を設けた感光体(特開昭47 - 10735 号公報谷照)などが挙げられる。これ らの有機感光体は、前記無機感光体の機械的特 性及び加工性をある程度までは改善したものの、 概して光感度が低く電子写真用感光体としての

(4)

即ち、本発明の第1の目的は

$$\bigcap_{N} \bigcap_{C \text{ H}} = N - N - \bigcap_{R}$$

〔 但し、 R はメチル基、フェニル基、ペンジ

ル基を表わす〕

で示されるヒドラゾン化合物を提供することであり、他の目的は式 $\bigcap_{\substack{N \ C_2H_5}}$ - CHO で示さ

れる9-エチルカルパゾール-3-アルデヒドと、一般式

〔但し、R は前記に同じ〕

で示される 1 - 置換フェニルヒドラジンとを反応させることにより前記新規ヒドラゾン化合物の製造法を提供することにある。

本発明を更に具体的に説明する為に、本発明 実施態様を述べると、本発明の前記にドラゾン 化合物は、常温において無色又は淡黄色の結晶

-400-

体であり、前記アルデヒドと、前記ヒドラジン とを等ヒル比で適当な有機溶剤中で反応せしめ ることにより容易に得られる。この脱水縮合反 応は、一般に知られている様に酸を添加すると ⁻とにより促進することができ、この様な酸触媒 として、塩酸、希硫酸などの無機酸、及び酢酸 のような有機酸が用いられる。反応溶媒として 用いられる有機溶剤としては、前記反応系が溶 解するものであれば、ほとんどの有機溶剤が使 用可能であり、メタノール、エタノールなどの 低級アルコール、1,4 - ジオキサン、テトラヒ ドロフランなどの選状エーテル、メチルセロソ ルプ、エチルセロソルプなどのセロソルプ類、 N,N - シメチルホルムアミド、酢酸などが挙げ られる。反応温度は用いる反応溶媒によって異 なるが、反応系の溶解性がよい N,N - ジメチル ホルムアミドなどを用いる場合には、室温で反 応は進行するが、反応系が室温で難溶をエタノ ールなどを用いる場合には、加熱環流すること が望ましい。いずれの場合も反応は1~5時間

(7)

を主成分とする電荷発生層 5 と、ヒドラゾン化 ¹ 合物を含む電荷移動層 6 からなる感光層 2 を設 ・ けたものである。

以下與施例を示す。

奥施例1

9-エチルカルパゾール-8-アルデヒド 22 8 9 (01 モル)を N,N-ジメチルホルム アミド 100 ml に溶解し、これに 1 規定の塩酸 5 ml を加え、 攪拌しつつ、 1 - メチルー 1 - フェニルヒドランン 13.4 9 (0.11 モル)を 30 分を 要して 高下した。 室温でさらに 1 時間 攪拌した後、メタノール 50 ml 及び水 50 ml を加え析出する 沈 般を アルノエタノールから 取 焼した後、酢酸エチルノエタノールから 再結晶 し、目的物を 得た。 得られたヒドラン 日 合物の 構造式、 収率、 融点、 元素 分析 値 は 表 1 に示す 通りであり、 赤外吸収スペクトルは第4 図に示した。

奥施例2-8

9~エチルカルパゾール-8~アルデヒドと、

1 - フェニルメチル - 1 - フェニルヒドラジン-401-

で終了する。反応の結果得られた縮合生成物が 結晶として析出する場合には、そのまま沪取し、 生成物が析出しない時は、希釈剤を用いて析出 せしめてから沪取する。沪取された生成物を更 に適当な溶剤を用いて再結晶することにより、 純粋なヒドラゾン化合物が得られる。

(8)

又は 1,1 - ジフェニルーヒドラジンとをそれぞれ 0.1 モルずつ用い実施例 1 と同様に縮合反応を起し、ヒドラゾン化合物を生成した。 得られたヒドラゾン化合物の構造式、収率、融点元素分析値は表 1 に示す通りであり、赤外吸収スペクトルは第 5 図及び第 6 図に示した。

赤外線吸収入やアク X 図5紙 第6区 無 計算値 6.48 1284 596 83.33 1041 83.25 0.7 逥 素分析 実測値 2.60 0.08 ıĸ ပ Ħ Ħ z 76.5% 156% 74.5% 刡 镹 (1780~ 80.0° (160.5∼ 2.5℃) 1280~ 30.0℃ 計設エデル/ エタノール 融点 (再結晶溶媒) (n-ブネノール) n-781-11) OTO-CH=N-N-O ONO CH=N-N-O ヒドラゾン化合物 -²2-∕⊙ 実施例 夕

ap

し、次いで、タングステンランプによって、その表面が照度 20 ルックスになるようにして光照射し、その表面電位が Vpo の½になるまでの時間 (秒) を求め、半滅露光量 B ½ (ルックス・秒) を得た。その結果は、 Vpo = -847V、 E ½ = 2.0 ルックス・秒であり、暗所における電荷の保持性、光感度がともに大であった。

4. 図面の簡単な説明

سن

表

第1図~第4図は本発明の新規なヒドラゾン 化合物を用いた電子写真用感光体の厚さ方向に 拡大した断面図である。

1 … 導電性支持体、 2,2',2' … 感光層、 3 … 電荷発生物質、 4 … 電荷移動媒体、 5 … 電荷発生層、 6 … 電荷移動層

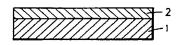
第4~第6図は本発明の新規なヒドラゾン化合物の赤外線吸収スペクトルである。

特許出願人 株式会社リコー 代理人 弁理士 小 松 秀 岳

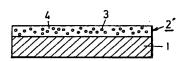
4',4" - ヒス(2-ヒドロキシ-3-フェニル カルパモイルー1ーナフチルアゾ)-1,4 -ス チリルペンゼン3重畳部、ポリエステル樹脂(商品名、ポリエステルアドヒーシブ 49000 :デ ュポン社製)1重量部、及びテトラヒドロフラ ン96重量部をポールミル中で粉砕、混合して得 た分散液をアルミニウムを蒸光したポリエステ ルフィルム上にドクタープレードを用いて塗布 し、80 ℃の乾燥器中で 5 分間乾燥して厚さ約 1 μの電荷発生層を形成せしめた。次いで、実施 例1で製造されたヒドラゾン化合物1重量部、 ポリカーポネート樹脂1重量部及びテトラヒド ロフラン8重量部からなる溶液を前記電荷発生 層上にドクタープレードを用いて塗布し、100 でで10分間乾燥し、厚さ約10 mの電荷移動窟を 形成した。との感光体について、市販の静電複 写紙試験装置を用いて、-6 KV のコロナ放電を 20 秒間行なって負に帯電せしめた後、20 秒間暗 所に放置し、その時の表面電位 Vpo (V) を測定

(12

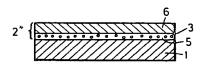
第 1 図

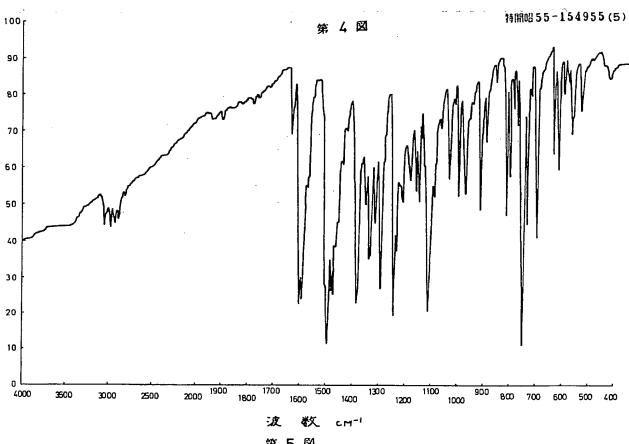


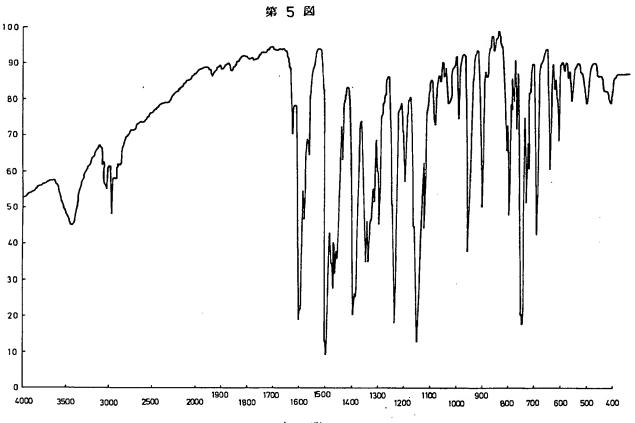
第 2 図



第 3 図

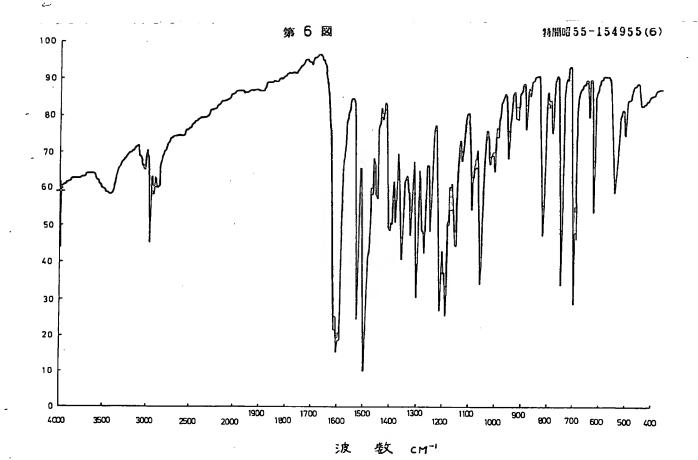






CM-1:

-403-



統補正 (自発) 昭和54年6 月25日

特許庁長官 川原能雄

1. 事件の安示

断 年 6 4 1 1 9 马 昭和54年

- 新規なヒドラゾン化合物及びその製造法
- 3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

フリガナ 住 所

フリガナ (名称) (674) 株式会社リコ

- 〒107 電582-7211内線22 4. ft 理
 - 東京都港区赤坂 4 丁目 1 3 番 5 号

赤坂オフイスヘイツ (7899) 弁理士 小 松



- 補正命令の日付
- 稲正により増加する発明の数
- 補正の対象

明細書中、発明の詳細な説動



8. 補正の内容

明細書第11頁の表1中、「ヒドラゾン化 合物」の欄を下記のとおり訂正する。

-404-

(3)